

<b>A 2 2</b> <b>初級</b> (実習あり)	<b>製品開発における知的財産リスク</b>  製品開発時に直面する知的財産リスクとその周辺の諸問題 これだけは押さえておきたい知的財産リスクのポイント
講師	船木 隆英 (日本パテントデータサービス(株) 顧問、元 キヤノン(株) 知財研修室 室長)
日程・場所	東京会場 11月19日(火)
時間	1日間(10:00~16:00) // 昼休憩 11:45~12:45
アクセス	<a href="http://www.jpds.co.jp/company/access.html">http://www.jpds.co.jp/company/access.html</a>
定員	24名(先着順申し込み)
受講料(税別)	20,000円
対象	研究開発者、知的財産部門の担当者
<b>内 容</b>	
<p>日頃の製品開発、製造や販売、部品等の購入などにおいて、知的財産リスクが潜んでいることが少なくありません。知的財産に関して無意識に業務を行っている大きな問題に巻き込まれてしまう危険性ははらんでいます。</p> <p>本講座では、製品開発を行う上で必要となる基本的な知的財産の知識、日々の業務で直面する知的財産のリスク予知と対応について学びます。最終的には自らが知的財産リスクを意識した業務ができるようになることを目標とします。受講には特別な知的財産の知識は不要です。</p>	
<b>プログラム</b>	
<p>1. 知的財産の基礎知識</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特許制度の目的</li> <li>・ 企業での知的財産の役割</li> <li>・ 特許を受けられる発明</li> </ul> <p>2. 製品開発で直面する業務上の主な知的財産リスク</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 模倣品</li> <li>・ 新製品の公開(販売)</li> <li>・ 警告</li> <li>・ その他の知財リスク</li> </ul> <p>3. 知的財産リスクに対する心構え</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 新製品を知的財産権で守る</li> <li>・ 他人の知的財産権を使用しない製品を作る</li> <li>・ その他の知的財産問題を含まない製品の販売をする</li> </ul>	<p>4. 製品開発段階における知的財産リスクへの対応</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 企画段階での知財対応</li> <li>・ 製品販売前の知財対応</li> <li>・ 製品販売後の知財対応</li> <li>・ その他</li> </ul> <p>5. 製品開発・販売の課程における知的財産リスク対応の事例研究</p>

## 【お申込み】

当社ホームページよりお申し込みください。 URL: <http://www.jpds.co.jp/seminar/application.html>

## 【備考】

セミナーご参加の方で事前にご質問や特に説明をお聞きになりたい内容がございましたらお申し出下さい。セミナー当日に可能な限りお答えさせていただきます。

## 【日本弁理士会継続研修について】

本研修は、日本弁理士会の継続研修としての認定を申請中です。本研修を受講し、所定の申請をすると、外部機関研修として単位が認められる場合があります。